附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 第一组 | 国标委发[2024]28号20241911-T-469 | 太阳能电池用硅单晶及硅单晶片 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2024]16号20240139-T-469 | 硅外延用三氯氢硅中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 讨论 |
|  | 待下达计划 | 流化床法颗粒硅用籽晶 | 乐山协鑫新能源科技有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-036-T/CNIA | 多晶硅生产用无水氯化铜 | 四川永祥新能源股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2024]80号2024-046-T/CNIA | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 硅多晶 | 四川永祥股份有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-042-T/CNIA | 光伏用半片单晶硅片 | 常州时创能源股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-039-T/CNIA | 半导体洁净室 空气分子污染物（AMC）掺杂剂B和P测定 电感耦合等离子体质谱法 | 天津中环半导体股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-040-T/CNIA | 半导体洁净室 水溶性空气分子污染物（AMC）的测定 离子色谱法 | 天津中环半导体股份有限公司 | 审定 |
|  | 第二组 | 国标委发[2023]58号20231108-T-469 | 碳化硅单晶片微管密度测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2023]58号20231112-T-469 | 碳化硅单晶片厚度和平整度测试方法 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2023]58号20231113-T-469 | 半导体晶片直径测试方法 | 麦斯克电子材料股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2024]28号20241932-T-469 | 碳化硅单晶 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2024]16号20240494-T-469 | 碳化硅单晶抛光片堆垛层错测试方法 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2023]58号20231111-T-469 | 半导体单晶材料透过率测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2023]64号20233951-T-610 | 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法 | 有研国晶辉新材料有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2024]16号20240143-T-469 | 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 讨论 |